1/1



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 09142878

(43) Date of publication of application: 03.06.1997

(51)Int.Cl.

CO3C CO3C 3/064 CO3C HO1B HO1J

(21)Application number: 07300114 (22)Date of filing, 17.11,1995

(71)Applicant: (72)Inventor:

TORAY IND INC MASAKI YOSHIKI

YOSHIMURA AKIKO IGUCHI YUICHIRO

(54) PHOTOSENSITIVE ELECTROCONDUCTIVE PASTE AND PRODUCTION OF **ELECTRODE**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a photosensitive electroconductive paste high in precision, suitably useful as an electrode for a large-size plasma display panel, by blending a glass frit containing a specific amount of Bi2O3 with electroconductive powder and a photosensitive organic component.

SOLUTION: This photosensitive electroconductive paste comprises a glass frit containing 10-80wt.% expressed in terms of oxide of B2O3, electroconductive powder and a photosensitive organic component. The glass frit has '80wt.% of a composition composed of 30-70wt.% of expressed in terms of oxide of Bi2O3, 3-30wt.% of SiO2, 2-25wt.% of B2O3 and 2-20wt, of ZnO. The electroconductive powder contains at least one selected from the group consisting of Ag, Au, Pd, Ni, Cu, Al and Pt. The photosensitive organic component contains a photosensitive polymer or an oligomer, a photosensitive monomer and a photopolymerization initiator.

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-142878

(43)公開日 平成9年(1997)6月3日

(51) Int. C1. 6	識別記号 庁内整理番号	FI技術表示箇所
C03C 8/18		CO3C 8/18
3/064		3/064
		4/14
4/14		HO1B 1/16 A
H01B 1/16	•	H01J 9/02 F
H01J 9/02		1013 5702
	審査請求 未確	情求 請求項の数12 OL (全13頁) 最終頁に続く
	- 1	
(21)出願番号	特願平7-300114	(71)出願人 000003159
		東レ株式会社
(22)出顧日	平成7年(1995)11月17日	東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
		(72)発明者 正木 孝樹
		滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株
4		式会社滋賀事業場内
	.9.	(72)発明者 芳村 亜紀子
٠		滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株
		式会社滋賀事業場内
		(72)発明者 井口 雄一朗
		滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株
		式会社滋賀事業場内

(54) 【発明の名称】感光性導電ペーストおよび電極の製造方法

(57)【要約】

【課題】微細パターンの形成が可能で、かつ低抵抗な回路パターンを与える感光性導電ペーストおよび電極の製造方法を提供する。

【解決手段】酸化物換算表記でBi, O, を10~80 重量%含有するガラスフリット、導電性粉末および感光 性有機成分を含有することを特徴とする感光性導電ペー ストにより達成される。 【特許請求の範囲】

【請求項1】酸化物換算表記でBi, O, を10~80 重量%含有するガラスフリット、導電性粉末および感光 性有機成分を含有することを特徴とする感光性導電ペー フト

【請求項2】ガラスフリットが酸化物換算表記で

Bi, O, 30~70重量%

S i O: 3 ~ 3 0 重量% B: O: 2 ~ 2 5 重量%

ZnO 2~20重量% の組成範囲からなるものを80重量%以上会有すること

を特徴とする請求項1記載の感光性導電ベースト。 【請求項3】導電性粉末が、Ag、Au、Pd、Ni、 Cu、AJおよびPtの群から選ばれる少なくども1種 を含有することを特徴とする請求項1記載の感光性導電 ベースト。

【蘭求項4】感光性有機成分が、感光性ポリマーもしく はオリゴマー、感光性モノマーおよび光重合開始剤を含 有することを特徴とする蘭求項1配載の感光性導電ペー スト。

【請求項5】感光性有機成分が、酸性基とエチレン性不 飽和基を有するアクリル系共重合体を含有することを特 徴とする請求項1記載の感光性導電ベースト。

【請求項6】紫外線吸光剤を含有することを特徴とする 請求項1記載の感光性連貫ペースト。

【請求項7】紫外線吸光剤が有機系染料からなることを 特徴とする簡求項6 記載の感光性進館ペースト。

【請求項8】紫外線吸光剤の含有量が導電性粉末に対して0.01から1重量%であることを特徴とする請求項6記載の感光性導電ベースト。

[蘭求項9] 導電性粉末の表面を紫外線吸光剤でコーティングし、その350~450nmにおける吸光度の積分値が30~70であることを特徴とする請求項6配載の吸光性準電ペースト。

【請求項10】請求項1から9いずれかに記載のプラズマディスプレイパネル用感光性導電ペースト。

【前求項11】請求項1から9いずれかに配載の感光性 導電ペーストを基板上に整布し、フォトリソグラフィで パターン形成した後、焼成することを特徴とする電極の 製造方法。

[請求項12] 請求項1から9いずれかに記載の感光性 導電ペーストを基板上に強布し、フォトリングラフィで パターン形成した後、焼成することを特徴とするブラズ マディスプレイパネル用質板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は感光性導電ペースト および電極の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、回路材料やディスプレイにおい

て、小型化や高密度化、高精細化、高信額性の要求が高まっており、それに伴って、パターン加工技術も技術向 よか望まれている。特に、導体回路パターンの微細化は 小型化、高密度化には不可欠な要求として各種の方法が 提案されている。

【0003】プラズマディスプレイパネル (PDP) は、液晶パネルに比べて高速の表示が可能であり、かつ 大型化が容易であることから、OA機器および情報表示 装置などの分野に浸透している。また、高品位テレビジ 10 ョンの分野などでの進展が非常に期待されている。

【0004】このような用途の拡大にともなって、PD Pは微細で多数の表示セルを有するカラーPDPが注目 されている。PDPは、前面ガラス基板と背面ガラス北 板との間に備えられた放電空間内で対抗するアノードお よびカソード電極間にプラズマ放電を生じさせ、上記放 電空間内に封入されているガスから発光させることによ り表示を行うものである。この場合、ガラス基板上のア ノードおよびカソード領板は、複数本の線状電板を平行 に配置されており、互いの電極が僅小な間隙を介して対 20 抗し、かつ互いの線状電極が交差する方向を向くように 重ね合わせて構成される。PDPの中で、蛍光体による カラー表示に適した3電板構造の面放電型PDPは、写 いに平行に隣接した一対の表示雷極からなる複数の雷極 対と、各軍極対と直交する複数のアドレス電極とを有す る。

【0005】上記のアドレス電極は、通常スクリーン印刷法でアドレス電極に対応するマスクパターンを有した印刷マスクを用いて、ガラス基板上に銀ペーストなどの導電ペーストを印刷した後焼成して形成される。しかしながら、スクリーン印刷法ではマスクパターン精度、スクイーズ硬さ、印刷速度、分散性などの最適化を図っても電極パターンの幅を100μm以下に細くすることができず、ファインパターン化には限界があった。また、スクリーン印刷による方法では、印刷マスクの精度は、マスク製版の構度に依存するので印刷マスクが大きくなるとマスクパターンの寸法既差が大きくなってしまう。このため30インチ以上の大面積のPDPの場合に、高精細のPDP作製がますます技術的に困難となっている。

40 【0006】さらに、PDPには透過型と反射型があるが、反射型では斉宙ガラスの発光階側にアドレス電極および絶縁層の隔壁(リプ)が設けられ、その後に電光体が形成されている。アドレス電極を導電ベーストで印刷し、乾燥させた後、隔壁用の印刷マスクによって絶縁ガラスペーストを所定の高さ、幅によって具なるが、焼成前の高さ200μmの隔壁では、15回以上重ねて印刷する。その後、導電ベーストおよび絶縁ベーストを一括に焼成してアドレス電極および隔壁を形成する。しかしながら、大型のPDPになればなるほどガラス基板の一端を基準として、隔壁用の位置合わせを行うと、ガラス

基板の他端では、すでに導館ペーストのパターンピッチ (印刷マスクの寸法精度に依存する) と隔壁用の印刷マ スクのパターンピッチとが累積されることから、アドレ ス電極と隔壁との間に大きな位置ずれが生じてしまう。 このため高精細な電極パターンが得られず、大型化も非 常に制限されるようになり、問題点の解決が必要となっ ている。

【0007】これらスクリーン印刷の欠点を改良する方 法として、特開平1-206538号公報、特開平1-296534号公報および特開昭63-205255号 10 寸法精度が低下するようになる。 公報に記載されているように絶縁ペーストを焼成後、導 電ペーストを印刷し、焼成して電板形状の改良を図った もの、アノードの電極形成にフォトリソグラフィ技術を 用いたものおよびフォトレジストを用いてフォトリソグ ラフィ技術による遵電ペーストが提案されているが、 微 細パターン形成に加えて低抵抗と大型化を同時に満足す る技術としては、十分ではなかった。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、微細 パターンの形成が可能で、かつ低抵抗な同路パターンを 20 得るのに好適な感光性導電ペーストおよび電極の製造方 法を提供することにある.

【0009】また、さらに本発明の目的は、高精細で、 かつ大型のプラズマディスプレイパネルの電極に好適に 使用することができる感光性導雷ペーストおよび雷極の 製造方法を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】かかる本発明の目的は、 酸化物換算表記でBi, O, を10~80重量%含有す るガラスフリット、導館性粉末および感光性有機成分を 30 含有することを特徴とする感光性導電ペーストおよびそ の感光性導電ペーストを基板上に塗布し、フォトリソグ ラフィでパターン形成した後、焼成することを特徴とす る電極の製造方法により達成される。

[0011]

【発明の実施の形態】すなわち、本発明は導電ペースト に感光性を付与し、これにフォトリソグラフィ技術を用 いて、微細で低抵抗な電極が効率よく形成できるように するものである。

【0012】本発明において使用される遵循性粉末は、 導電性を有する粉末であればよいが、好ましくはAg、 Au、Pd、Ni、Cu、AlおよびPtの群から選ば れる少なくとも1種を含むもので、ガラス基板上に60 0℃以下の温度で焼き付けできる低抵抗の導電性粉末が 使用される。これらは単独、合金または混合粉末として 用いることができる。混合粉末の例としては、例えばA g (80~98) -Pd (20~2), Ag (90~9 8) -Pd (10~2) -Pt (2~10), Ag (8 5~98) - Pt (15~2) (以上()内は重量% を表わす)などの2元系や3元系の混合金属粉末等を用 50 (4)ジアゾ化合物の無機塩や有機酸とのコンブレック

いることができる.

[0013] これらの導電性粉末の平均粒子径は0.7 ~6 umが好ましい。より好ましくは1. 3~5 umで あり、さらに好ましくは1.6~4.0μmである。平 均粒子径が0.7 um未満と小さくなると紫外線の露光 時に光が印刷後の膜中をスムーズに透過せず、電極導体 の最小線幅60μm以下の微細パターンの形成が困難と なる。また平均粒子径が6μmを越えて大きくなると印 刷後の回路パターンの表面が粗くなり、パターン精度や

4

[0014] 導電性粉末の比表面積は0.15~3m² /gであることが好ましい。より好ましくは、0.17 ~1.5m¹ /gであり、さらに好ましくは、0.2~ 0.65m²/gである。比表面積が0.15m²/g 未満では電極パターンの精度が低下する。また3m2 / gを越えると粉末の表面積が大きくなり過ぎて紫外線が 散乱されて、下部まで露光硬化が十分行われたいために 現像時に剥がれが生じてパターン精度が低下する。

【0015】また、導電性粉末のタップ密度は3~5g /ccであるのが好ましい。タップ密度がこの範囲にあ ると紫外線汚過性が良く、循板パターン精度が向上す る。さらに、ペーストの印刷後の塗布膜で緻密な膜が得 られる。

【0016】導電性粉末の形状は、板状、円錐状、棒状 のもの等も使用できるが、単分散で凝集がなく、球状で あることが好ましい。この場合、球状とは球形率が90 個数%以上が好ましい。球形率の測定は、粉末を光学顕 微鏡で300倍の倍率にて撮影して計数し、球形のもの の比率を表わした。球状であると露光時に紫外線の散乱 が非常に少なくなり、高精度のパターンが得られ、照射 エネルギーが少なくて済む。

【0017】本発明における感光性有機成分とは、感光 性導電ペースト中の感光性を有する化合物を含む有機成 分のことである。

【0018】本発明の感光性導館ペーストに関しては、 感光性化合物の含有率が感光性有機成分の10重量%以 上であることが光に対する感度の点で好ましい。さらに は、30重量%以上であることが好ましい。

【0019】感光性化合物としては、光不溶化型のもの と光可溶化型のものがあり、光不溶化型のものとして、

- (1) 分子内に不飽和基などの官能基を1つ以上有する モノマー、オリゴマー、ボリマーのうち少なくとも1種 類からなるもの
- (2) 芳香族ジアゾ化合物、芳香族アジド化合物、有機 ハロゲン化合物などの感光性化合物
- (3) ジアゾ系アミンとホルムアルデヒドとの縮合物な どいわゆるジアソ樹脂といわれるもの 等がある。
- 【0020】また、光可溶型のものとしては、

ス、キノンジアゾ類

(5) キノンジアゾ類を適当なポリマーバインダーと結 合させた、例えばフェノール、ノボラック樹脂のナフト キノン1,2-ジアジド-5-スルフォン酸エステル 等がある。

【0021】本発明においては、上記の全てを用いるこ とができるが、取扱いの容易性や品質設計の容易性にお いては、上記(1)が好ましい。

[0022] 分子内に官能基を有する感光性モノマーの 具体的な例としては、メチルアクリレート、エチルアク 10 る。 リレート、ロープロピルアクリレート、イソプロピルア クリレート、nープチルアクリレート、secープチル アクリレート、sec-ブチルアクリレート、イソブチ ルアクリレート、tert-プチルアクリレート、n-ベンチルアクリレート、アリルアクリレート、ベンジル アクリレート、プトキシエチルアクリレート、プトキシ トリエチレングリコールアクリレート、シクロヘキシル アクリレート、ジシクロベンタニルアクリレート、ジシ クロベンテニルアクリレート、2-エチルヘキシルアク リレート、グリセロールアクリレート、グリシジルアク 20 リレート、ヘプタデカフロロデシルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、イソポニルアクリレー ト、2-ヒドロキシプロピルアクリレート、イソデキシ ルアクリレート、イソオクチルアクリレート、ラウリル アクリレート、2-メトキシエチルアクリレート、メト キシエチレングリコールアクリレート、メトキシジエチ レングリコールアクリレート、オクタフロロペンチルア クリレート. フェノキシエチルアクリレート、ステアリ ルアクリレート、トリフロロエチルアクリレート、アリ ル化シクロヘキシルジアクリレート、1,4-ブタンジ 30 オールジアクリレート、1、3-ブチレングリコールジ アクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ジ エチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリ コールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアク リレート、ジベンタエリスリトールヘキサアクリレー ト、ジペンタエリスリトールモノヒドロキシベンタアク リレート、ジトリメチロールプロパンテトラアクリレー ト、グリセロールジアクリレート、メトキシ化シクロへ キシルジアクリレート、ネオベンチルグリコールジアク リレート、プロピレングリコールジアクリレート、ポリ 40 プロピレングリコールジアクリレート、トリグリセロー ルジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリ レート、アクリルアミド、アミノエチルアクリレート、 フェニルアクリレート、フェノキシエチルアクリレー ト、ベンジルアクリレート、1-ナフチルアクリレー ト、2-ナフチルアクリレート、ビスフェノールAジア クリレート、ピスフェノールA-エチレンオキサイド付 加物のジアクリレート、ピスフェノールA-プロピレン オキサイド付加物のジアクリレート、チオフェノールア

アクリレート類、スチレン、ローメチルスチレン、ロー メチルスチレン、m-メチルスチレン、α-メチルスチ レン、クロロメチルスチレン、ヒドロキシメチルスチレ ンなどのスチレン類、また、これらの芳香環中の水素原 子の一部もしくはすべてを塩素、臭素原子、ヨウ素ある いはフッ素に置換したもの、および上記化合物の分子内 のアクリレートの一部もしくはすべてをメタクリレート に変えたもの、ァーメタクリロキシプロピルトリメトキ シシラン、1-ビニル-2-ピロリドンなどが挙げられ

【0023】本発明ではこれらを1種または2種以上使 用することができる。これら以外に、不飽和カルボン酸 等の不飽和酸を加えることによって、感光後の現像性を 向上することができる。不飽和酸の具体的な例として は、アクリル酸、メタアクリル酸、イタコン酸、クロト ン酸、マレイン酸、フマル酸、ビニル酢酸、またはこれ らの酸無水物などがあげられる

【0024】一方、分子内に官能基を有するオリゴマー やポリマーの例としては、前述のモノマーのうち少なく とも1種類を重合して得られた、分子内に官能基を1つ 以上有するオリゴマーやポリマー、もしくは、官修基を 有さないオリゴマーやポリマーの側鎖または分子末端に 官能基を付加させたものなどを用いることができる。少 なくともアクリル酸アルキルあるいはメタクリル酸アル キルを含むこと、より好ましくは、少なくともメタカリ ル酸メチルを含むことによって、熱分解性の良好な重合 体を得ることができる。

【0025】好ましい官能基は、エチレン件不飽和基を 有するものである。エチレン件不飽和基としては、ビニ ル基、アリル基、アクリル基、メタクリル基などがあげ られる。

【0026】このような官能基をオリゴマーやポリマー に付加させる方法は、ポリマー中のメルカプト基。 アミ ノ基、水酸基やカルボキシル基に対して、グリシジル基 やイソシアネート基を有するエチレン性不飽和化合物や アクリル酸クロライド、メタクリル酸クロライドまたは アリルクロライドを付加反応させて作る方法がある。

【0027】グリシジル基を有するエチレン件不飽和化 合物としては、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グ リシジル、アリルグリシジルエーテル、エチルアクリル 酸グリシジル、クロトニルグリシジルエーテル、クロト ン酸グリシジル、イソクロトン酸グリシジルなどがあげ られる。

[0028] イソシアネート基を有するエチレン性不飽 和化合物としては、(メタ)アクリロイルイソシアネー ト、(メタ) アクリロイルエチルイソシアネート等があ

[0029] また、グリシジル基やイソシアネート基を 有するエチレン性不飽和化合物やアクリル酸クロライ **クリレート、ベンジルメルカブタンアクリレートなどの 50 ド、メタクリル酸クロライドまたはアリルクロライド**

は、ポリマー中のメルカプト基、アミノ基、水酸基やカ ルポキシル基に対して0.05~1モル当量付加させる ことが好ましい。

【0030】また、不飽和カルボン酸等の不飽和酸を共 重合することによって、感光後の現像性を向上すること ができる。不飽和酸の具体的な例としては、アクリル 酸、メタアクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、マレイ ン酸、フマル酸、ビニル酢酸、またはこれらの酸無水物 などがあげられる.

【0031】こうして得られた側鎖にカルボキシル基等 10 の酸性基を有するオリゴマーもしくはポリマーの酸価

(AV) は50~180、さらには70~140の範囲 が好ましい。酸価が50未満であると、現像許容幅が狭 くなる。また、酸価が180を越えると未露光部の現像 液に対する溶解性が低下するようになるため理像波濃度 を濃くすると露光部まで剥がれが発生し、高精細なパタ ーンが得られにくい。

【0032】 さらにパインダーとして、ポリビニルアル コール、ポリビニルブチラール、メタクリル酸エステル 重合体、アクリル酸エステル重合体、アクリル酸エステ 20 ルーメタクリル酸エステル共取合体、αーメチルスチレ ン重合体、ブチルメタクリレート樹脂などの非感光性の ポリマーを加えてもよい。

【0033】感光性モノマーをオリゴマーやボリマーに 対して0.05~10倍量用いることが好ましい。より 好ましくは0.1~3倍量である。10倍量を越えると ペーストの粘度が小さくなり、ペースト中での分散の均 一性が低下する恐れがある。0.05倍量未満では、未 露光部の現像液への溶解性が不良となりやすい。

[0034] 本発明においては、感光性導電ペースト中 に、ガラスフリットを含有する。ガラスフリットは導雷 性粉末をガラス基板上に強固に焼き付けるために必要で あり、また運賃件粉末を焼結するための焼結助剤の効果 や導体抵抗を下げる効果があるためである。ガラスフリ ットのガラス転移温度(Tg)およびガラス軟化点(T s) は焼き付け温度を下げる点からは低いほうが好まし <. Tgが300~500℃、Tsが350~450℃ であるのが良い。より好ましくはTgが350~450 ℃であるのが良い。 Tgが低すぎると有機成分が蒸発す る前に焼結が始まるので好ましくない。Tgが500℃ 40 を越えるガラスフリットでは600℃以下の焼き付け温 度で行ったときにガラス基板との接着性が劣る結果とな るので好ましくない。

【0035】本発明においては、ガラスフリットの組成 としては、Bi, O, は10~80重量%の範囲で配合 する。10重量%未満の場合は、遮雷ペーストをガラス 基板上に焼き付けする時に、ガラス転移点や軟化点を制 御するのに十分でなく、基板に対する接着強度を高める のに効果が少ない。また80重量%より多くなるとガラ

成分が蒸発する前にガラスフリットが溶融する。このた めペーストの脱パインダー性が悪くなり、導体膜の焼結 性が低下し、また基板との接着強度が低下する。

【0036】さらに、ガラスフリットが、酸化物換算表 記で

Bi, O, 30~70重量% SiO. 3~30重量% в, о, 2~25重量% 7. n O 2~20重量%

の組成範囲からなるものを80重量%以上含有すること が好ましい。この範囲であると500~600℃で導体 膜をガラス基板上に強固に焼き付けできるガラスフリッ トが得られる。

【0037】特に、本発明のガラスフリット組成中によ れば、感光性有機成分のゲル化反応を起こしやすいPb O等を用いずに好ましいガラスフリットを得ることがで き、ゲル化反応によるパターン形成不良を起こさない安 定な導館ペーストを得ることができる。

[0038] SiO, は3~30重量%の範囲で配合す ることが好ましく、3重量%未満の場合は基板上に焼き 付けたときの接着強度やガラスフリットの安定性が低下 する。また30重量%より多くなると耐熱温度が増加 し、600℃以下でガラス基板上に焼き付けが難しくな

【0039】B, O, は2~25重量%の範囲で配合す ることが好ましい。 B, O, は導雷ペーストの雷気締殺 性、強度、熱膨張係数などの質気、機械および熱的特件 を損なうことのないように焼き付け温度を500~60 0℃の範囲に制御するために配合される。2重量%未満 では密着強度が低下し、また25重量%を越えるとガラ スフリットの安定性が低下する。

【0040】 ZnOは2~20重量%の範囲で配合する ことが好ましい。2重量%未満では導電ペーストをガラ ス基板上に焼き付けする時に、焼き付け温度を制御する のに効果が少ない。20重量%を越えるとガラスの耐熱 温度が低くなり過ぎてガラス基板上への焼き付けが難し

【0041】ガラスフリット粉末には、ブラズマの放電 特性を劣化させるNa,O、Y,O,、K,0などの酸 化物金属を含まないことが好ましい。含有した場合にも 5 重量%以下である。

[0042] また、ガラスフリット中にAl, O,、B aO、CaO、TiO:、ZrO:、Li: Oなどを含 有することによって熱膨張係数、ガラス軟化点、ガラス 転移点、絶縁抵抗を制御できるが、その量は15重量% 未満であることが好ましい。

[0043] 使用するガラスフリットの粒子径は、微粒 子であればあるほど、低温で融解するので好ましい。5 0%径が0.5~2μmの範囲、90%径が0.7~3 スフリットの軟化点が低くなり過ぎてペースト中の有機 50 μmの範囲が好ましく、低温で融解し、ガラス基板上に 強固に接着するので好ましい。

【0044】感光性導電ペースト中のガラスフリット含有量としては、1~5重量%であることが好ましい。より好ましくは1.5~3.5重量%である。PDPのアノードおよびカソード電極の低抵抗化を図るにはガラスフリットの量が低いほうが好ましい。ガラスフリットは電気絶縁性であるので含有量が5重量%を越えると電極の抵抗が増大するので好ましくない。1重量%以下では、電極膜とガラス基板との強固な接着強度が得られにくい。

【0045】本発明において用いられる感光性導電ペースト中には、必要に応じて光重合開始剤、紫外線吸光 利、増感剤、増感剤)、重合禁止剤、可塑剤、増粘剤、 有機溶媒、酸化防止剤、分散剤、沈殿防止剤などの添加 剤成分が加えらる。

[0046] 本発明で使用する光重合開始剤の具体的な 例として、ベンゾフェノン、o-ベンゾイル安息香酸メ チル、4.4-ピス (ジメチルアミン) ベンゾフェノ ン、4,4-ビス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン、 α-アミノアセトフェノン、4、4-ジクロロベンソフ 20 エノン、4ーベンゾイルー4ーメチルジフェニルケト ン、ジベンジルケトン、フルオレノン、2,2-ジエト キシアセトフェノン、2、2-ジメトキシ-2-フェニ ルー2-フェニルアセトフェノン、2-ヒドロキシー9 -メチルプロピオフェノン、p-t-ブチルジクロロア セトフェノン、チオキサントン、2-メチルチオキサン トン、2-クロロチオキサントン、2-イソプロピルチ オキサントン、ジエチルチオキサントン、ベンジル、ベ ンジルジメチルケタノール、ベンジルーメトキシエチル アセタール、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、 ベンゾインプチルエーテル、アントラキノン、2-t-ブチルアントラキノン、2-アミルアントラキノン、β ークロルアントラキノン、アントロン、ベンズアントロ ン、ジベンゾスベロン、メチレンアントロン、4-アジ ドベンザルアセトフェノン、2,6-ビス(p-アジド ベンジリデン) シクロヘキサノン、2,6-ビス(p-アジドベンジリデン) -4-メチルシクロヘキサノン、 2-フェニルー1. 2-ブタジオン-2-(o-メトキ シカルボニル) オキシム、1-フェニループロパンジオ ン-2-(0-エトキシカルボニル)オキシム、1、3 40 -ジフェニループロパントリオン-2-(o-エトキシ カルボニル) オキシム、1-フェニル-3-エトキシー プロパントリオン-2- (o-ベンゾイル) オキシム、 ミヒラーケトン、2-メチルー[4-(メチルチオ)フ エニル] -2-モルフォリノ-1-プロパノン、ナフタ レンスルホニルクロライド、キノリンスルホニルクロラ イド、N-フェニルチオアクリドン、4、4-アゾビス イソプチロニトリル、ジフェニルジスルフィド、ベンズ チアゾールジスルフィド、トリフェニルホルフィン、カ

ルホン、過酸化ペンソインおよびエオシン、メチレンブ ルーなどの光度元性の色素とアスコルピン酸、トリエタ ノールアミンなどの境元剤の組合せなどが挙げられる。 本発明ではこれらを1種または2種以上使用することが できる。

[0047] さらに、光重合開始剤は、感光性有機成分

[0049] すなわち、通常、寒電性粉末だけでは、紫 外線が1μm以下の導電性粉末や不均一な形状の導電性 粉末によって散乱されて余分な部分まで光硬化し、 銀条である。 できなくなることが起こりやすい。この原め のが現像できなくなることが起こりやすい。この原め について本発明者らが数後検討を行った結果、散乱され た紫外光が吸収されて、あるいは弱められて露光マスク による遮光部分にまでまわり込むことが原因であること が判明した。したがって紫外線吸光剤を添加することによって散乱光のまわり込みがほぼ回避され、マスク部分 の感光性有機成分の硬化を防ぎ、露光マスクに相当した パターンが形成される。

【0050】紫外線吸光剤としては250~520nmの該長範囲で高いUV吸収係数を有するものが好ましく用いられ、中でも350~450nmの該長範囲で高いUV吸収係数を有する有機系染料が好ましく用いられる。有機系染料としてアゾ系染料、アミノケトン系染料、アシテン系染料、アントラキノン系、ベンゾフェノン系、ジフェニルシアノアクリレート系、トリアジン系、ルーアミノ安息香酸系染料などが使用できる。有機系染料は吸光剤として添加した場合にも、焼成後の種種導体膜中に残存しないで導体膜特性の低下を少なくできるので好ましい。これらの中でもアゾ系およびベンゾフェノン系染料が行ましい。これらの中でもアゾ系およびベンゾフェノン系染料が行ましい。

プロパントリオン-2 - (o - ベンゾイル) オキシム、ミヒラーケトン、2 - メチルー (4 - (メチルチオ) フェニル] - 2 - モルフォリノ - 1 - プロパノン、ナフタレンスルホニルクロライド、キノリンスルホニルクロライド、キノリンスルホニルクロライド、トリフスルホニルクロライド、カーフェニルチオアクリドン、4、4 - アゾビス イソプチロニトリル、ジフェニルジスルフィド、トリフェニルホルフィン、カンファーキノン、四臭衆化炭素、トリプロモフェニルス 50 H, N:NC,-H, O H= 262.3 1) オイルパイナ

レット (Oil Violet, C₁, H₁, N₁ = 37 9. 46)、オイルイエローOB (Oil Yello w OB, CH₁ C, H₁ N:NC₁, H₁ NH₁ = 26 1. 33) などである。

[0052] ベンゾフェノン系染料としては、ユピナールD-50 (C₁, H₁, O₁ = 246.22、2,2^{*},4,4^{*}ーテトラハイドロオキシベンソフェノン)、ユピナールMS40 (C₁, H₁, O₁ S=308、2-ヒドロキシー4-メトキシベンソフェノン5-スルフォン酸)、ユピナールDS49 (C₁, H₁, O₁, S₁, Na₁ = 10478、2,2-ジヒドロキシー4,4^{*}ージメトキシベンソフェノン-5,5^{*}ージスルフォン酸ナトリウム)などがあるが、250~520 nmで吸収することができる染料が使用できる。

【0053】紫外線吸光剤の添加量は、0.01から1 重量%が好ましい。より好ましくは0.01から0.3 重量%であり、さらに好ましくは0.02~0.1重量 %である。0.01重量%未満では添加効果が低く、パ ターンの切れや滲みやエッジ師のカールをなくす効果が 少ない。1重量%を越えると紫外線吸収効果が大きくな 20 り過ぎて、現像時に携が剥がれやすくなったり、高精細 なパターン形成ができにくい。

[0054] 紫外線受光剤の添加方法の好ましい一例を 示すと、以下の様になる。紫外線受光剤を予め有機溶媒 に溶解した溶液を作製する、火に該有機溶媒中に導電性 粉末を程合後、乾燥することによってできる。この方法 によって導電性粉末の個々の粉末表面に均質に紫外線吸 光剤の膜をコーディングしたいわゆるカブセル状の粉末 が作戦できる。

[0055] 本発明において、好ましい吸光度の積分値 30 (波長測定範囲:350~450nm)の範囲がある。 吸光度の積分値は、粉末の状態で測定されるもので、紫 外線吸光剤でコーティングした粉末について測定され

[0056] 本発明で、吸光度は下記のように定義される。すなわち、市販の分光光度計を使用して積分球の中で光を測定用試料に当て、そこで反射された光を集めて

検出する。また積分球により検出された光以外は、すべ て吸収光とみなして下記の式から求められる。

[0057] 対照光の光強度をIr、(Irは試料の吸 光度を測定する前に、積分球内面に塗布してある材料と 同じ材料のBaSO, を試料台に取り付けて反射による 米強度を測定したデーケ)

試料に入射した光の光強度をI、試料に当たった後、吸収分の光強度をI G とすると、試料からの反射分の光強度は (I-IG) で表わされ、吸光度は下配の(1) 式ように定義される。上記で光強度の単位は、W/G m^2 で表わす。

【数1】

吸光度の測定は下記のようにして行う。

- 1. 紫外線吸光剤を添加した粉末をプレス機で直径20 mm、厚み4mmのサイズに成型する。
- 2. 次に分光光度計を用いて積分球の反射試料の取り付け口に粉末の成型体を取り付けて、反射光による吸光度 りを波長範囲200~650nmで測定すると図1のよう なグラフが得られる。縦軸は(1)式の吸光度で、横軸 は測定波長を示す。
 - 3. 次に図1で波長350~450nmの範囲を10nm毎の10区間に分け、それぞれの区間毎の面積を求める。面積は次のように求められる。

[0058] 例えば、

350nmのときの吸光度を0.75

360nmのときの吸光度を0.80

370 nmのときの吸光度を0.85

440 nmのときの吸光度を0.60

450nmのときの吸光度を0.55として、

350~360 nmの部分の面積を(i) とし、台形とみなすと(i) は下記のように計算される。

[0059] [数2]

350~360 nmの面積(1) =
$$\frac{(0.75+0.80)\times10}{}$$
 = 7.75

同様に面積(2) は

・・同様に面積(10)は

 $440 \sim 450$ nmの面積(10) = $\frac{(0.60+0.55) \times 10}{2} = 5.75$

となる。

して求められる。

[0060] 10区間の面積の積分値Sは下記のように 50 S=(1)+(2)+(3)+・・・・+(10)

上記の面積Sを吸光度として定義した。

【0061】本発明で上配の吸光度の積分値の好ましい 範囲は、30~70であり、さらに好ましい範囲は35 ~60である。吸光度が30未満であると紫外緯酸光時 において光が導体膜の下部まで十分透過する前に導電性 粉末によって散乱されて未露分節を硬化するようにな り、高解像度のパターン形成ができない。また吸光度が 70を超えると光が導体膜のの下部に遵する前に準電性 粉末に吸収されてしまい、下部の導体膜まで光が透過し ないため光硬化できなくなる。この結果、現像時に剥が 10 れるようになり、電極の形成が困難になる。

【0062】 本発明においてガラスフリットに微量合まれるこ aO、BaO、Fe,O、K,O、Na,O などの金属および酸化物が感光性有機成分と反応してペーストが短時間でゲル化し、塊となりペーストとして印刷できなくなったり、現像ができなくなってパターン形成できなくなったり、現像ができなくなってパターできなくなる場合がある。これはイオン架橋反応によるゲル化と推定されるが、このような反応を防止するために、悪い影響を与えない範囲で変化に刺き添加してゲル化を防止することが好ましい。すなわち、ゲル化反広を1号き起こす金属あるいは酸化物粉末との錯体化あるいは酸管能差との塩形成などの効果のある化合物で粉末を表別性関係でストを変化させる。そのような安定化剤としては、トリアゾール化合物の中でも特にベンソトリアゾールが合効に作用する。

【0063】 本発明において使用されるペンソトリアソールによるガラスフリット粉末の表面処理は次のようにして行うと好ましい。すなわちガラスフリットに対して所定の量のペンゾトリアソールを酢酸メチル、酢酸エチル、エチルアルコール、メチルアルコールなどの有機溶験に溶解した後、これら粉末が十分に浸す事できるように溶液中に3~24時間浸積する。浸積後、好ましくは20~30℃下5白熱乾燥して溶媒を蒸発させてトリアソール処理を行った後、50~80℃で5~12時間、真空乾燥して粉末を作動する。

(0064) 本発明において使用される安定化剤のガラスフリットに対する割合は0.2~4重量%が好ましく、さらに0.4~3重量%であることがより好ましい。0.2重量%未満では栄養反応を防止するのに効果 40がない。また4重量%を越えると安定化剤の量が多くなり過ぎて非酸化性雰囲気中での導電ベーストの焼成時においてポリマー、モノマーおよび安定化剤などの脱パインターが困難となり、操体膜の特件が低下する。

【0065】また上記において導電ベースト中に微量含 有する水分が存在すると導電ベーストのゲル化を促進す る。これを防止するため感光性有機成分(感光性ボリマー、感光性モノマー、光重合開始剤、増感剤、増感剤、大重合促 進剤、可塑剤、増粘剤、有機溶経、有機分散剤など)に 微震含有する水分を除去するのが好ましい。水分の除去

は、固体か液体かの種類によって異なるが、真空乾燥机 理、モレキュラシーブ、ロータリーエパポレイターなど で除去する。さらに、ガラスフリットの場合は、ガラス フリットを150~200℃で5~15時間乾燥して水 分を十分除去するとゲル化が防止できるので好ましい。 【0066】本発明において、ガラスフリットに加えて 焼結助剤となる金属および/または金属酸化物を添加す ると、導電性粉末が焼結時に異常粒子成長を同避でき る、あるいは焼結を遅らせるなどの効果があり、その結 果、導体膜とガラス基板との接着強度をあげる効果があ る。そのような焼結助剤としてCu、Cr、Mo、Al あるいはNiなどの金属および/または金属酸化物が使 用できる。これらのうちで金属酸化物は電気的に絶縁物 として作用するので添加物の量は少ない方がよく、3重 畳%以下である。3重量%を越えると導体膜の電気抵抗 が増加するのでよくない。また、金属酸化物と金属を併 用することも好ましく行われる。

【0067】増感剤は、感度を向上させるために添加さ れる。増感剤の具体例としては、2,3-ビス(4-ジ エチルアミノベンザル)シクロペンタノン、2.6-ピ ス(4 - ジメチルアミノベンザル)シクロヘキサノン、 2. 6-ビス (4ージメチルアミノベンザル) - 4-メ チルシクロヘキサノン、ミヒラーケトン、4.4-ビス (ジエチルアミノ) ベンソフェノン、4.4ードス(ジ メチルアミノ) カルコン、4、4-ビス(ジエチルアミ カルコン、pージメチルアミノシンナミリデンイン ダノン、ロージメチルアミノベンジリデンインダノン. 2 - (p - ジメチルアミノフィニルビニレン) イソナフ トチアソール、1、3ービス(4ージメチルアミノベン ザル) アセトン、1、3-カルポニルービス (4-ジエ チルアミノベンザル)アセトン、3,3-カルポニルー ビス (7 -ジエチルアミノクマリン)、 N-フェニルー N-エチルエタノールアミン、N-フェニルエタノール アミン、Nートリルジエタノールアミン、Nーフェニル エタノールアミン、ジメチルアミノ安息香酸イソアミ ル、ジエチルアミノ安息香酸イソアミル、3-フェニル -5-ベンゾイルチオテトラゾール、1-フェニル-5 - エトキシカルボニルチオテトラゾールなどが挙げられ る。本発明ではこれらを1種または2種以上使用するこ とができる。なお、増感剤の中には光重合開始剤として も使用できるものがある。

(0068) 増感剤を本発明の導電ベーストに添加する 場合、その添加量は感光性有機成分に対して通常0.1 ~30重量%。より好ましくは0.2~20重量%である。増感剤の量が少なすぎれば光感度を向上させる効果 が発揮されず、増感剤の量が少なずぎればが悪ぎされば観光部の残存率 が小さくなりすぎるおそれがある。

一、感光性モノマー、光重合間始期、増密剤、光重合促 [0069]本発明の導電ペーストにおいて保存時の熱 連剤、可塑剤、増粘剤、有機溶媒、有機分散剤など)に 変定性を向上させるため、熱重合禁止剤を振加すると良 欲量含有する水分を除去するのが好ましい。水分の除去 50 い。熱重合禁止剤の具体的な例としては、ヒドロキノ 15

ン、N-ニトロソジフェニルアミン、フェノチアジン、 ロ・t・ブチルカテコール、N-フェニルナフチルアミン、2、6・ジ・t・ブチルー p-メチルフェノール、 クロラニール、ピロガロールなどが挙げられる。熟重な 禁止剤を添加する場合、その添加量は、感光性導電ペースト中に、適常、0.1~5重量%、より好ましくは、 0.2~3重量%である。熱重合禁止剤の最少かなすぎれば、保存時の熱的な安定性を向上させる効果が発揮されず、終重合禁止剤の量が多すぎれば、の光郎の残存率がからくなりすぎるおそれがある。

【0070】可塑剤としては、例えばジフチルフタレート(DBP)、ジオクチルフタレート(DOP)、ポリエチレングリコール、グリセリンなどが用いられる。

【0071】また本発明の遵循ペーストには保存時にお けるアクリル系共重合体の酸化を防ぐために酸化防止剤 を添加できる。酸化防止剤の具体的な例として2.6-ジーtーブチルーpークレゾール、ブチル化ヒドロキシ アニソール、2,6-ジーt-4-エチルフェノール、 2. 2-メチレン-ビス- (4-メチル-6-t-ブチ ルフェノール)、2,2-メチレン-ピス-(4-エチ 20 ルー6-t-ブチルフェノール)、4,4-ビス-(3 -メチル-6-t-ブチルフェノール)、1,1,3-トリスー(2-メチルー6-t-ブチルフェノール)、 1, 1, 3-トリスー(2-メチルー4-ヒドロキシー t-ブチルフェニル) ブタン、ピス[3,3-ビス-(4-ヒドロキシ-3-t-ブチルフェニル) ブチリッ クアシッド] グリコールエステル、ジラウリルチオジブ ロピオナート、トリフェニルホスファイトなどが挙げら れる。酸化防止剤を添加する場合、その添加量は通常、 感光性導電ペースト中に、0.01~5重量%、より好 30 ましくは0.1~1重量%である。酸化防止剤の量が少 なければ保存時のアクリル系共同重合体の酸化を防ぐ効 果が得られず、酸化防止剤の量が多すぎれば露光部の残 存率が小さくなりすぎるおそれがある。

【0072】 本発明の感光性発電ベーストには、溶液の 粘度を調整したい場合、有機溶媒を加えてよい。このと き使用される有機溶媒としては、メチルセロソルブ、エ チルセロソルブ、ブチルセロソルブ、メチルエチルケト ン、ジオキサン、アセトン、シクロロキサノン、シクロ ベンタノン、イソブチルアルコール、イソプロピルアル 40 コール、テトラヒドロフラン、ジメチルスルフォキシ ド、ァーブチロラクトンなどがあげられる。これらの有 機溶媒は、単独あるいは2種以上併用して用いることが できる。

【0073】感光性導電ペーストの好ましい組成範囲を 例示すると、

- (a) 導電性粉末 ; (a) 、(b) 、(c) の 和に対して84~94重量%
- (b) 感光性ポリマーと感光性モノマー; (a)、
- (b)、(c)の和に対して15~3重量%

- (d) 光重合開始剤 ; (b) 対して5~20重量
- (e) 紫外線吸光剤 ; (a) に対して0.01~ 1重量%

この範囲にあると露光時において紫外線がよく透過し、 光硬化の機能が十分発揮され、現像時における露光部の 膜強度が高くなり、微細な解像度を有する電極パターン 10 が形成できる。

【0074】さらに必要に応じて光重合促進剤、分散物、チキソトロピー剤、抗療防止剤等を添加し、混合かのスラリーとする。所定の類似皮となるように調整され、スラリーはホモジナイザなどの複拌機で均質に複拌混合した後、3本ローラや混練機で均質に分散し、ペーストを作製する。

【0075】ベーストの粘度は導電性粉末、有機溶媒およびガラスフリットの組成・種類、可塑剤、チキソトロピー剤、沈殿防止剤、有機のレベリング剤などの添加剤 のたまって適宜調整されるが、その範囲は2000~2 0万cps (センチ・ポイズ)である。例えばガラス基 板への整布をスクリーン印刷法やパーコータ、ローラコ ータ、アプリケータで1~2回盤布して膜厚10~20 μmを得るには、3万~20万cpsが好ましい。

[0076] 次に本発明の感光性等電ペーストを用いて PDPの電極パターンなどを形成する方法について説明 する。すなわち、本発明の感光性準電ベーストは、ガラ ス基板上に通常スクリーン印刷法等で強布される。印刷 呼みはスクリーンの材質(ポリエステルまたはステンレ ス製)、メッシュおよび張力、ペーストの粘度を調製す ることによって任意に制御できるが、5~30 μ m であ る。さらに好ましい厚みの範囲は8~20 μ m である。 5 μ n 未満になると印刷法では均質は厚みを得ることが 難しくなる。また30 μ m を越えると電極パターンオ が低下したり、断面形状が逆台形になり、最小線幅 外線間隔が30 μ m / 30 μ m 以下の高精細なパターン やエッジ切れがよく滲みのないパターンが得られ難くな る。

【0077] なお、感光性遠電ペーストをガラス基板上 いた整布する場合、基板と整布膜との密着性を高めるため に基板の表面処理を行うとよい。表面処理液としてはシ ランカップリング剤、例えばビニルトリクロロシラン、 ビニルトリメトキシシラン、ピニルトリエトキシラン、 アーグリシドキシブロピルトリメトキシシラン、ァーグリシドキシブロピルトリメトキシシラン、ァー (2−アミノエデル)アミノブロピルトリメトキシシラン、 アークロロプロピルトリメトキシシラン、ァーメル カブトブロピルトリメトキシシラン、アーメル カブトブロピルトリメトキシシラン、アーメル カブトブロピルトリメトキシシラン、アーノブロピ 機チタン、有機アルミニウム、有機ジルコニウムなどで ある。シランカップリング初あるいは有機金属を有機窓 媒例えばエチレングリコールモノメチルエーテル、エチ レングリコールモノエチルエーテル、メチルアルコー ル、エチルアルコール、プロビルアルコール、プチルア ルコールなどで0.1~5%の濃度に希釈したものを用 いる。次にこの表面処理液をスピナーなどで基板上に均 一に塗布した後に80~140℃で10~60分間乾燥 する事によって表面処理ができる。

【0078】次にこのような感光性導電ペーストを基板 [0 上に塗布した膜を70~120℃で20~60分加熱し て乾燥して溶媒類を蒸発させてから、フォトリソグラフ ィー法により、電極パターンを有するフィルムまたはク ロムマスクなどのマスクを用いて紫外線を照射して露光 し、感光性ペーストを光硬化させる。この原使用される 活性光源としては、紫外線、電子線、X線などが挙げら れるが、これらの中で紫外線が好ましく、その光源とし てはたとえば低圧水銀灯、高圧水銀灯、ハロゲンラン プ、殺菌灯などが使用できる。これらのなかでも超高圧 木銀灯が好適である。露光条件は導体膜の厚みによって 20 異なるが、5~100mW/cm²の出力の超高圧水銀 灯を用いて1~30分間露光を行なうのが好ましい。 【0079】次に現像液を用いて前記露光によって硬化

していない部分を除去し(いわゆるネガ型の)電極パタ 一ンを形成する。現像は、浸漬法やスプレー法等で行な う。現像液としては前記の感光性有機成分の混合物が溶 解可能である有機溶媒を使用できる。また該有機溶媒に その溶解力が失われない範囲で水を添加してもよい。ま た、酸性基を持つ化合物が存在する場合、アルカリ水溶 液で現像できる。アルカリ水溶液として水酸化ナトリウ 30 ム、炭酸ナトリウムや水酸化カルシウム水溶液などのよ うな金属アルカリ水溶液を使用できるが、有機アルカリ 水溶液を用いた方が焼成時にアルカリ成分を除去しやす いので好ましい。有機アルカリの具体例としては、テト ラメチルアンモニウムヒドロキサイド、トリメチルベン ジルアンモニウムヒドロキサイド、モノエタノールアミ ン、ジエタノールアミンなどが挙げられる。アルカリ水 溶液の濃度は通常 0.05~5重量%、より好ましくは 1~2重量%である。アルカリ濃度が低すぎれば未 露光部が除去されずに、アルカリ濃度が高すぎれば、露 40 光部を腐食させるおそれがあり良くない。

【0080】次に、露光、現像後の塗布膜を空気中で焼 成する。感光性有機成分である感光性ポリマー、感光性 モノマーなどの反応性成分およびバインダー、光重合開 始剤、紫外線吸光剤、増感剤、増感助剤、可塑剤、増粘 剤、有機溶媒、分散剤あるいは溶媒などの有機物が完全 に酸化、蒸発される。温度条件として500~600℃ より好ましくは、520~580℃で15分~1時間体 成し、ガラス基板上に焼き付けることが好ましい。50 **0℃未満では焼成を十分に行うことが困難になり、60 50 8)、酸化亜鉛 (2.6)、酸化アルミニウム (2.**

0℃を越えると基板が劣化したり、熱変形を起こしたり しゃすい。

[0081] 本発明の感光性導電ペーストの調合、印 刷、露光、現像工程では紫外線を遮断できるところで行 う必要がある。そうでないとペーストあるいは途布職が 紫外線によって光硬化してしまい、本発明の効果を発揮 できる導体膜が得られない。

【0082】本発明の感光性導電ペーストを用いて電極 パターンを形成した場合、例えば焼成後の導体膜の厚み が5~30μmにおいて導体の最小線幅が30μm、導 体間の最小線間隔30 μm程度の高精細のパターンが得

[0083]

【実施例】以下の実施例で、本発明を具体的に説明す る。以下に示すA~Kの材料およびa~gの手順で質極 を形成、評価した。

【0084】下記の実施例において、濃度は特に断らな い限りすべて重量%で表わす。

【0085】A. 導爾性粉末

①Ag粉末:単分散粒状、平均粒子径3.7μm、比表 面積0.48m²/g

②Ag粉末;単分散粒状、平均粒子径4.55μm、比 表面積 0.55 m²/g

③Ag粉末;球状、球形率95個数%、平均粒子径2. 2 μm、比表面積 0. 2 6 m² / g

④95%Ag-5%Pd粉末;単分散粒状、平均粒子径 3. 3 μm、比表面積 0. 8 2 m² / g

粒度分布は、レーザ式粒度分布測定装置(HORIBA LA-700) で測定した。

【0086】B、感光性ポリマー(以下、ポリマーと略 す)

40%のメタクリル酸 (MAA)、30%のメチルメタ クリレート (MMA) および30%のスチレン (St) からなる共重合体にMAAに対して0. 4当量のグリシ ジルメタクリレート (GMA) を付加反応させたポリマ

C. 感光性モノマー (以下モノマーと略す) トリメチロールプロパントリアクリレート D. ガラスフリット

ガラスフリット I ; 成分 (重量%) 酸化ビスマス (4 5.1)、二酸化ケイ素(27.5)、酸化ホウ素(1 2.5)、酸化亜鉛(2.6)、酸化ナトリウム(4. 7)、酸化アルミニウム (2.8)、酸化ジルコニウム (4.8)

ガラスフリット!! ;成分(重量%)酸化ピスマス(5 0)、二酸化ケイ素 (7)、酸化ホウ素 (15)、酸化 亜鉛(14)、酸化パリウム(14)

ガラスフリットIII :成分 (重量%) 酸化ビスマス (6 6.9)、二酸化ケイ素 (10)、酸化ホウ素 (11.

8)、酸化ジルコニウム(4.8)

F 宏外線吸光剂

①アゾ系染料:スダン(Sudan)、化学式; C:4H , ON, O、分子量; 380. 45

のアゾ系染料:オイルイエロー (Oil Yellow OB)、化学式: CH, C, H, N: NC, H, NH , 、分子量; 261.33

F. 溶媒

ィープチロラクトン

G. 光重合開始剤

2-メチル-1- [4-(メチルチオ) フェニル] -2 ーモルフォリノー1ープロパノンと2、4ージエチルチ オキサントンをポリマーとモノマーとの総和に対して2 0%添加した。

H. 可塑制

ジプチルフタレート (DBP) をポリマーの10%添加 した。

1. 始成都

2. 4-ジエチルチオキサントンをポリマーとモノマー との総和に対して20%添加した。

J. 增感助剤

n - ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル (EPA) をポリマーとモノマーとの総和に対して10%添加し た。

化 熔料剂

酢酸2-(2-ブトキシエトキシ) エチルに溶解させた SiO, (濃度15%) をポリマーに対して4%添加し

[0087] a. 有機ピヒクルの作製

溶媒およびボリマーを混合し、攪拌しながら80℃まで 30 加熱しすべてのポリマーを均質に溶解させた。ついで溶 液を容温まで冷却し、光重合開始剤を加えて溶解させ た。その後、溶液を400メッシュのフィルターを通過 し、濾過した。

【0088】b、吸光剤添加粉末の作製

紫外線吸光剤を所定の量秤量し、イソプロピルアルコー ル (IPA) に溶解させた溶液に分散剤を加えてホモジ ナイザで均質に攪拌した。次に、この溶液中に導電性粉 末を所定の最添加して均質に分散・混合後、ロータリー し、IPAを蒸発させた。こうして紫外線吸光剤の膜で 導電性粉末の表面を均質にコーティングした(いわゆる カブセル処理した)粉末を作製した。

【0089】c. ペースト作製

上記の有機ビヒクルに紫外線吸光剤でカブセル処理した 導雷性粉末、モノマー、可塑剤、増感剤、増咸助剤 増 粘剤、ガラスフリットおよび溶媒を所定の組成となるよ うに添加し、3本ローラで混合・分散してベーストを作 製した。ペーストの組成を表1に示す。

[0090] d. 印刷

上記のペーストを325メッシュのスクリーンを用いて ガラス基板 (430mm角で、厚み3mm) 上に400 10 mm角の大きさにベタに印刷し、80℃で40分間保持 して乾燥した。乾燥後の塗布膜の厚みは組成によって異 なるが、12~15 μmであった。

【0091】e. 蘇光、現像

上記で作製した塗布膜を40~70μmのファインパタ ーンを有するプラズマディスプレイパネル用電板を形成 したクロムマスクを用いて、上面から500mW/cm *の出力の超高圧水銀灯で紫外線露光した。次に25℃ に保持したモノエタノールアミンの0.5重量%の水溶 液に浸漬して現像し、その後スプレーを用いて未露光部 20 を水洗浄した。

[0092] f. 焼成

ガラス基板上に印刷した塗布膜を空気中、580℃で1 5分間焼成を行い、電極導体膜を作製した。

[0093] g. 評価

焼成後の賃極膜について膜厚、解像度、賃極膜端部の工 ッジカール性、比抵抗、接着強度を測定し、評価した。 膜原は走杏電子顕微鏡 (SEM) にて断面を観察して求 めた。解像度は導体膜を顕微鏡観察し、40 μm幅のラ インが直線で重なりなくかつ再現件が得られるライン間 隔を評価した。エッジカールは表面粗さ計で電極パター

ンの端部の知さおよび断面を顕微鏡観察して評価した。 接着強度は粘着テープを電板面に張り付け、その剥離度 合いで評価した。比抵抗はシート抵抗を測定し、膜厚か ら計算で求めた。

[0094] 比較例

上記のAg粉末のを用い、ガラスフリットIおよびIII の酸化ビスマスをそれぞれ酸化鉛に置き換えた以外は上 記の実施例と同じ条件にてペーストを作製した。作製し たペーストを容器に入れ密封した状態にし室温で1時間 エパポレータを用いて、150~200℃の温度で乾燥 40 放置したところ、いずれのペーストもゲル化し印刷不能 となり、ペーストとして使用できなかった。

[0095]

【表1】

成分	実施例1	実施例2	实施例3	突热例 4	突旋例 5	交互列6	实施例7
OAg粉末、1.7st. 0.18s */g	8 5	8.6	9 2				
②A g 粉末、 4.55点, 4.551" /t				90	9 0		
ØA g 粉末、1.2;a, 6.26s * /g		٠.				8.8	8 8
@1584g-589 688, 1. \$pa, 6. 81a ' /r							
** 1 v -	8 .	6	2. 5	4	8	6	ż
モノマー	8	3	2. 5	2	3	8	2
ガラスフリット! ・.	3	3	8			3	
ガラスフリットロ				4			
ガラスフリット車					4		3
常外線吸光剤Φ:スダン	0. 01	0.02	0. 05	0. 07	0.07	0.07	0. 4
常外接吸光剤②:オイルイエロー							
吸光皮	40	41	4.5	4 6	4.6	4.5	6.0
統成後の鎮運(μα)	8	9	10	9	9	8 .	10
第 位 度 (# m)	8 0	8 0	4.0	8 0	3 0	40	5 0
比板技 (#·Q·cm)	8. 0	2. 7	. 2. 5	8. 0	2. 8	. 2. 7	8. 2
雑草のエッジカールの有集	.46	t⊈ b	.# L	なし	なし	αL	¢ι
制龍強度	剝却なし	観察なし	剝離なし	製錬なし	製菓なし	刺激なし	製器なし

[表2]

成分	実施例を	実施例9	实趋例10	突旋例11	去连约12	实施例13
DAg粉末、\$. Tan. Q. 46m * /s			8 8	8 8	8.8	9 2
ØAg₩#, 1.55;s, 6.55m* /;				111		
②Ag粉末、1.1ga, 1.26g * /f	190					
@#5\$At-5XfdBE. 1. 1 ca. 8. 42 . /r	8.8	80			-	
# 9 v-	7	4	7	7	. 7	2.
モノマー	2	4	2	ż	2	8
ガラスフリット1	3	2				
ガラスフリットロ			3	3	3	
ガラスフリット な						9
常外線吸光剤①:スダン			0. 4	0. feL		0. 0 Z
祭外継吸先剤②;オイルイエロー	0. 01	0.05			.0. 4	
吸光度	40	- 45	5 5	3 5	8.0	4 2
始成後の額厚(μm)	9	9	9	9	9 .	9
無数度(#m)	3.0	3 0	6.0	6.0	6.0	4 0
比茲抗 (µQ·cm)	2. 9	2. 8	2. 8	2. 9	2. 8	2. 9
揺割のエッジカールの有価	άι	426	643474	663614	64116	PUCT
対策発圧	朝鮮なし	製器なし	利益なし	剝煙なし	利益なし	剥離なし

[0096]

【発明の効果】このように感光性導電ペーストを用いて フォトリソグラフィー法により高精細のパターン解像度 が得られ、端部のエッジカールもなく、かつ低抵抗を有 する電極パターンが形成できた。特に、スクリーン印刷 50 トリソ法を用いた感光性導電ペーストは、ベタ印刷した

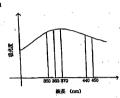
では、マスクパターンの寸法精度の限界やパターンピッ チの累積によって生ずる位置ずれの問題から大型化が困 難であったブラズマディスプレイパネルの高精細化、高 信頼性を得るのに特に有利である。また、本発明のフォ 23

面にマスクパターンを通して露光後、現像してパターン が形成できるので寸法精度の問題も大幅に減少し、かつ 高精度のマスクで位置合わせができるので大型化に一層 有利である。 【図面の簡単な説明】

[図1] 測定波長と吸光度の関係を示すグラフであ

[図1]

1



フロントページの続き

(51) Int.C1. 6

始別記号 庁内整理番

FI

技術表示箇所

1